



XXXIII SIC SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Evento	Salão UFRGS 2021: SIC - XXXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2021
Local	Virtual
Título	Fatores de persistência em cursos à distância
Autor	THAIS REZENDE MACHADO
Orientador	MARA LUCIA FERNANDES CARNEIRO

Fatores de persistência em cursos à distância

O projeto visa identificar os fatores que contribuem para a permanência dos alunos em cursos a distância, em contraposição ao conceito de evasão, que normalmente se foca na identificação das causas que fizeram os alunos desistirem ou se afastarem de um curso. Considera-se aqui persistência como as ações realizadas pelo aluno para continuar no curso, superando os eventuais obstáculos que foram sendo apresentados ao longo de sua participação. Foi realizada uma análise preliminar dos dados de 415 alunos, persistentes ou que cursaram e abandonaram em algum momento do curso, caracterizados como “abandono com aquisição de conhecimento”, de seis (6) edições do curso de aperfeiçoamento a distância “Farmacêuticos na APS: trabalhando em rede”, oferecido entre abril de 2014 e dezembro de 2017. Adotamos um modelo de análise prévia e avaliamos aspectos sociodemográficos, habilidades e experiências anteriores. Cerca de 71,6% dos estudantes que foram persistentes eram do sexo feminino, 70,4% tinham cursado alguma pós-graduação, 73,0% relataram ter experiência no ensino a distância, 73,0% apresentavam maior carga horária de trabalho, 82,8% informaram melhores conexões e 71,2% equipamentos para acesso à internet, 71,2% eram organizados e 70,4% consideravam-se bons leitores. Identificamos características que podem influenciar na persistência de alunos de cursos à distância, importantes resultados que auxiliam o delineamento de estratégias objetivando reduzir a evasão e auxiliar mais alunos a concluírem cursos à distância. O projeto prevê agora a análise dos relatórios de acesso ao ambiente Moodle, de forma a avaliar a influência da organização do tempo de estudo e interação com os materiais e equipe de professores e tutores sobre a persistência.